アセンブリによる Smart Skin Display 用フレキシブル基板貫通配線の形成と評価 Fabrication and Characterization of Through-X Via (TXV) for Smart Skin Display [•]荒山 俊亮¹, 煤孫 祐樹², 小田島 輩², 星 匡朗¹, 木野 久志³, 田中 徹²³, 福島 誉史²³ (1. 東北大工, 2. 東北大院工, 3.東北大院医工)

°S. Arayama¹, Y. Susumago², T. Odashima², T. Hoshi¹, H. Kino³, T. Tanaka^{2, 3}, and T. Fukushima^{2,3}

(¹ School of Engineering, Tohoku Univ, ² Graduate School of Engineering, Tohoku Univ, ³ Graduate School of Biomedical Engineering, Tohoku Univ), E-mail: link@lbc.mech.tohoku.ac.jp

1. 緒言

これまで, FOWLP (Fan-Out Wafer-Level Packaging) によ り、ミニ LED とマイクロ LED、および 3D-IC チップレッ トのアレイをフレキシブル基板に埋め込んだ生体情報の 取得・解析・表示が可能なスマートスキンディスプレイを 提案した[1][2]. ミニ LED から皮膚に赤色光や近赤外光を 照射し、3D-IC 表面のフォトダイオードにより反射光の強 度を測定することで、血中酸素飽和度(SpO2)や血量、血管 の位置など複数の生体情報を取得し、3D-IC 上に積層され たマイクロ LED を通して表示できる. この新しいフレキ シブル・ハイブリッド・エレクトロニクス(FHE)に必須なへ テロ集積化には、フレキシブル樹脂基板の表裏を接続する 貫通配線 Through-X Via (TXV, ここで X は PDMS やハイ ドロゲル,フレキシブルエポキシ等を指す)を形成する必 要がある.本研究では、従来の電解めっきでは煩雑になる 高背貫通配線の形成に対し、微細な銅ピラーのアセンブリ と FOWLP を用いて TXV を形成し、特性評価を行った.

2. 実験

評価試料の作製方法を図1に示す.まず,Siウエハ上に 熱剥離テープAを貼り,直径 300µm,高さ300µmの銅ピ ラーをチップボンダーでアセンブリして仮接着した.次い で,銅ピラーを埋めるように高制御フィルムアプリケータ を用いて PDMS を 300µm の厚さで塗布して硬化した.そ の後,パリレン1µmを蒸着し,フォトリソグラフィとドラ イエッチングによりパリレンをパターニングした.その上 にTi15nm,Au500nmをスパッタし,フォトリソグラフィ とウェットエッチングにより表面配線を形成した.続いて 熱剥離テープBを貼ったSiウエハにサンプル全体を反転 して転写し,熱剥離テープAを剥離した.さらに表面配線 と同様に裏面配線を形成した.最後に熱剥離テープBを剥 離し,TXVを介して表裏面を接続する配線を形成した.

3. 結果と考察

熱剥離テープ Rivalpha 上にピッチ 800µm で仮接着され た銅ピラーの写真を図2に示す.本研究の Chip-first 法に よる FOWLP では、半田マイクロバンプなどを使用するこ となく表裏面の配線とTXVを接続することが可能である. ここでは、厚さ 300µm の PDMS 基板に内蔵した銅ピラー からなる2本のTXV に繋がる前記配線のI-V 特性の結果 を図3に示す.この図から、PDMS 裏面の配線から PDMS に埋め込まれた2本の貫通配線 TXV を介して得られた配 線の電流と電圧は線形関係にあり、オーミックな接続が得 られていることが分かる. 配線抵抗が理論値より高い点は, 銅ピラーの酸化等の対策を検討して報告する.また,発表 では作製した両面配線の繰り返し曲げ耐性の評価につい ても述べる. μLED のマストランスファも進展し、このよ うな微小コンポーネントのアセンブリに基づくシステム 集積はチップレット化を加速する.今回の「ワイヤレット」 とも呼べる新技術は、今後の放熱設計等にも期待できる.





Fig. 2 A photograph of copper pillars fixed on Rivalpha.



Fig. 3 I-V characteristics of a pair of TXV with a bottom wiring.

4. まとめ

両面電極 LED の使用等を想定し,高度にヘテロ集積化した FHE の実現のため、微細銅ピラーのアセンブリにより PDMS 基板に貫通配線 TXV を介した両面配線を作製した. TXV の寸法を変えることで直径 100µm,高さ 500µm など の貫通配線の形成も可能となり,厚さのある基板にも対応 できる.現段階では逐次的な実装であるが、当研究室で開 発した表面張力を駆動力とする自己組織化実装技術を併 用すれば超並列なアセンブリも可能となる.

謝辞

本研究の一部は科研費 19KK0101, 21H04545 を用いて行われた.また,本研究は,東京大学 VDEC の活動を通して,日本ケイデンス株式会社の協力で行われたものである.

参考文献

[1] 煤孫ら,第82回応用物理学会秋季学術講演会予稿集, p. 11-063 (2021)
[2] Y. Susumago and T. Fukushima *et al.*, IEEE ECTC, pp. 34-39 (2021).